DWPI

DERWENT-ACC-NO: 1995-203279

DERWENT-WEEK: 199527

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Laser marking - comprises transmitting laser beam before progressing to condenser lens, through beam diameter-adjusting optical system composed of

lenses, and thereby adjusting dot diameter, etc. NoAbstract PATENT-ASSIGNEE: NIPPON STEEL CORPLYAWAI PRIORITY-DATA: 1993JP-0263793 (October 21, 1993)

PATENT-FAMILY:

JP 07116869 A

PUB-NO PUB-DATE

LANGUAGE

MAIN-IPC

N/A 005 B23K 026/00

PAGES.

May 9, 1995 APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP07116869A

N/A

1993JP-0263793

October 21, 1993

INT-CL_(IPC): B23K026/00; B23K026/04; B23K026/06; B41J002/44;

B41M005/24; G02B026/10; G02B027/09 ABSTRACTED-PUB-NO: JP07116869A

EQUIVALENT-ABSTRACTS: CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/5

DERWENT-CLASS: M23 P55 P75 P81 X24

CPI-CODES: M14-A04; M23-D05;

EPI-CODES: X24-D03;

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-116869

(43)公開日 平成7年(1995)5月9日

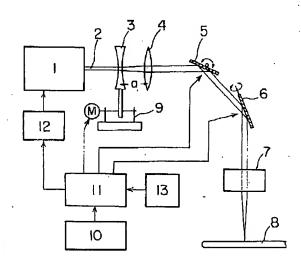
(51) Int.Cl. ⁶ B 2 3 K	26/00	識別記号 B	庁内整理番号	FI				技術表示箇所
		. N				•		
:	26/04	С						
				B 4 1 J	3/ 00		ς	2
			7036-2K	G 0 2 E	27/ 00 _		E	E
			審査請求	未請求 請求	項の数 2	OL (全 5 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平5-263793		(71)出願丿	00000665	55		
					新日本製	鐵株式会	≷社	
(22)出願日		平成5年(1993)10月		東京都千	代田区大	大手町2丁	目6番3号	
			(72)発明者	(72)発明者 清藤 哲生			•	
				·	福岡県北	九州市戸	畑区大字	中原46-59 新
				日本製鐵	株式会社	上機械・ブ	ラント事業部内	
•			- (72)発明者	(72)発明者 杉橋 敦史				
					神奈川県	相模原市	消費辺5	-10-1 新日
					本製鐵株	式会社工	レクトロ	ニクス研究所内
				(74)代理人	、 弁理士	田村 弘	以明 (外	·1名)
		•						
							•	

(54)【発明の名称】 レーザ刻印方法

(57)【要約】

【目的】 金属、ガラス、プラスチック等の各種製品等に、種々のパターンを刻印する場合、パターンの大きさや形状に応じて、集光レンズを交換せずビーム集光径を調整することにより、容易かつ迅速に、視認性の高い刻印表示を得る。また、製造工程で深彫り刻印する場合、ビーム集光径を変えても、所要深さの深彫り刻印を得る。

【構成】 集光レンズに入射する前のレーザビームを、2枚以上のレンズで構成されるビーム径調整光学系に透過させ、該光学系のレンズ間距離を調整することにより、刻印パターンを構成するドットまたは線密度に応じて、該ドット径または線幅を調整する。調整されたドット径または線幅に応じて、レーザビームの出力密度を調整する。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 集光レンズによりレーザビームを被加工 物上に集光して刻印する方法において、集光レンズに入 射する前のレーザピームを、2枚以上のレンズで構成さ れるビーム径調整光学系に透過させ、該ビーム径調整光 学系のレンズ間距離を調整することにより、刻印パター ンを構成するドットまたは線密度に応じて、該ドット径 または線幅を調整することを特徴とするレーザ刻印方 法。

【請求項2】 調整されたドット径または線幅に応じ て、レーザピームの出力密度を調整することを特徴とす る請求項1記載のレーザ刻印方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、金属、ガラス、プラス チック等の表面に、レーザ加工により種々のパターンの 刻印を任意のドット径あるいは線幅で施す方法に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】金属、ガラス、プラスチック等の製品 20 へ、文字、数字、模様等のパターンを刻印する場合に、 レーザ加工装置が使用されている。刻印に際しては、文 字等のパターンをドットで構成する場合、線で構成する 場合等があり、いずれの場合も、レーザビームを集光レ ンズにより絞り、被加工物をレンズの焦点面に位置さ せ、レーザピームを走査して刻印を行っている。

【0003】また、鋼材など金属材料等の製造工程にお いて、材料識別のため、表面に文字や数字等を刻印する 場合にも、レーザ加工装置が使用されている。この場 合、刻印された材料を熱処理したり脱スケール処理して 30 も判読できるように、刻印は深彫り加工されていなけれ ばならない。従来のレーザ刻印技術の公知文献として は、例えば特開昭60-106686号公報が知られて いる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記各種製品等の刻印 において、英数字等の低密度パターンと、漢字や複雑な マーク等の高密度パターンが混在した場合、従来技術で は、髙密度パターンの視認性が著しく損なわれるという 問題があった。すなわち、刻印のドット径や線幅は、集 40 光レンズ焦点でのビーム集光径によって決まり、同一加 工面においてビーム集光径を変化させることが困難なた め、高密度バターンでもビーム集光径を細くできず、太 いドット径や線幅で刻印せざるをえなかったからであ る。

【0005】集光レンズを取り替えて、焦点位置におけ るピーム集光径を変えるには、レンズ交換およびレンズ と被加工物との間隔調整が必要となり、連続ラインでの 刻印には採用できない。また、加工面を集光レンズの焦 点位置から外し、レーザビーム径の太い部位で刻印する 50 る。そして図 2 (b) に示す f θ レンズ 7 への入射ビー

ことも考えられるが、この場合も、刻印パターン毎にレ ンズと被加工物の間隔調整が必要である他、被加工物表 面のわずかな「うねり」によっても刻印部分のヒーム径 が変動するので、刻印形状が不均一なものとなる。そし て、いずれの場合も、ピーム集光径を変えると、レーザ のパワー密度が変化して、刻印の深さが変動する。

【0006】本発明は、金属、ガラス、プラスチック等 の各種製品等に、種々のパターンの刻印を行う場合、刻 印するパターンの大きさや形状に応じて、集光レンズを 交換することなく、ピーム集光径を最適値に調整するこ とにより、刻印パターンを構成するドット径または線幅 を調整し、容易かつ迅速に視認性の高い刻印表示を得る・ ことを目的とする。また、金属材料等の製造工程で材料 識別のための深彫り刻印を行う場合において、ビーム集 光径を変えても、所要深さの深彫り刻印を得ることを目 。 的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明のレーザ刻印方法は、集光レンズによりレー ザビームを被加工物上に集光して刻印する方法におい て、集光レンズに入射する前のレーザピームを、2枚以 上のレンズで構成されるピーム径調整光学系に誘過さ せ、該ピーム径調整光学系のレンズ間距離を調整するこ とにより、刻印パターンを構成するドットまたは線密度 に応じて、該ドット径または線幅を調整することを特徴 とする。そして、調整されたドット径または線幅に応じ て、レーザビームの出力密度を調整するのが望ましい。 [0008]

【作用】以下、本発明を図面に示す例により説明する。 図1は、オプティカルスキャナ方式のレーザ刻印方法お よび装置を示し、レーザ光源1から放射されるレーザビ ーム2を、X軸ガルバノスキャナ5およびY軸ガルバノ · スキャナ6で走査し、f θ レンズ7で集光し、該レンズ 7の焦点面に置いた被加工物8の表面に刻印を行う。こ の方式では、ガルバノスキャナ5および6の走査によ り、 $f\theta$ レンズ7上に文字等のパターンを描くと、その パターンが刻印される。

【0009】本発明法は、図1のように、集光レンズと して f θ レンズ 7 を使用することができ、 f θ レンズ 7 に入射する前のレーザビーム2を、凹レンズ3および凸 レンズ4から構成されるビーム径調整光学系に透過さ せ、両レンズの間隔 a を調整することにより、 f θ レン ズ7の焦点面におけるビーム集光径を調整する。間隔a は、図1のように、レンズ間隔調整機構9により凹レン ズ3をレーザピーム2の軸方向に移動する他、凸レンズ 4を移動して調整してもよい。

【0010】このような本発明法において、凹レンズ3 と凸レンズ4の間隔aを変化させると、図2(a)に示 すレーザビーム2のビーム径を変化させることができ

ム径Dが変化し、 $f \theta \nu \lambda \chi \gamma \eta$ の焦点面におけるビーム 集光径dが(1)式により変化する。

$$d = K f \lambda / D \tag{1}$$

ここで、Kは定数、fは f θ レンズの焦点距離、 λ はレ ーザピームの波長である。また凹レンズ3の焦点距離を f: 、凸レンズ4の焦点距離をf2とすると、(2)式 で示されるAaと、入射ビーム径Dおよびビーム集光径 dとの関係は図3のようになる。

$$\Delta a = (f_2 - f_1) - a \tag{2}$$

きは、凹レンズと凸レンズの間隔 a を、図 3 (b) のよ うに、 $\Delta a = A$ としてビーム集光径 dを太くし、パター ン密度の高い漢字や複雑なマーク等を刻印するときは、 間隔aを狭め、Δa=Bとしてピーム集光径dを細くす ることができ、両パターンが混在する刻印でも、ドット 径または線幅を調整でき、共に視認性を高めることがで きる。このように、f θ レンズ7を交換せず、f θ レン ズ7と被加工物8の面の間隔を調整する必要もなく、ビ ーム集光径dを容易にかつ迅速に変化させることができ るので、オンラインでの高速刻印が行える。

【0011】なお、ビーム集光径 dを太くすると、 dが 細いときと同一の出力でレーザビーム2を放射した場合 は、ビームのパワー密度が減少するので、刻印の深さが 浅くなる。そこで、深彫り刻印を行う場合は、ビーム集 光径 d を大にしたら、ビームの出力密度を高めて、所定 深さの刻印を行うよう調整する。

【0012】さらに、本発明のより具体的手段を図1の 例により説明する。刻印パターンを入力装置10から制 御用コンピュータ11に入力し、パルスジェネレータ1 3から制御用コンピュータ11に入力しているパルス を、レーザ発信用パルスとしてレーザ用電源12に出力 し、レーザ光源1からパルス状のレーザピーム2を発信 させる一方、制御用コンピュータ11の出力によりX軸 ガルパノスキャナ5およびY軸ガルパノスキャナ6を作 動させて、所望のパターンを $f \theta$ レンズ 7 上に描かせ、 さらに制御用コンピュータ11の出力により、レンズ間 隔調整機構9のモータを作動してレンズ間隔aを調整す る。また、ビーム集光径dに応じてレーザのパワー密度 を調整するときは、制御用コンピュータ11の指示によ りレーザ用電源12の出力を調整する。なお、この例で 40 は刻印がドットで行われるが、線で行う場合はパルジェ ネレータ13は不要で、制御用コンピュータ11の指示 によりレーザビーム2の発信をオンオフすればよい。

【0013】以上述べた本発明において、集光レンズと して $f \theta$ レンズを使用し、レーザビーム 2 の走査を、図 1のようなX軸ガルパノスキャナ5およびY軸ガルパノ スキャナ6で行う他、普通の凸レンズを使用したヘッド を機械的にXY走査して行うこともできる。また、ビー ム径調整光学系としては、図1のような単一の凹レンズ 3 と凸レンズ 4 を使用する他、各レンズを収差を小さく 50 6:Y軸ガルバノスキャナ

するための組合わせレンズとしてもよいのはもちろんの こと、さらに図2 (c) のように2枚の凸レンズ4-1 および4-2を使用することもできる。

[0014]

【実施例】

(本発明例) 図1に示す装置により、鋼板に各種パター ンの刻印を行った。レーザとしてはパルス励起YAGレ ーザを使用し、パルス幅をO. 5~1 msec、レーザのパ ルス出力はピーム集光径 d に応じて、4~7 J の範囲で したがって、パターン密度の低い英数字等を刻印すると 10 調整した。各刻印のドットの直径は、ビーム集光径dを **調整して0.7~1.0mmの範囲で変化させ、深さは** 0. 3 mmとした。結果は図4に示すとおり、視認性の高 い刻印パターンが加工でき、容易に判読できるものであ った。

> 【0015】(従来例)上記本発明例において、ビーム 🙃 集光径 d の調整を行わず、各刻印のドットの直径を1. 0 mmに固定し、レーザのパルス出力を、7 J 一定とし た。結果は図5に示すとおり、パターン密度の高い刻印 は不鮮明なものであった。

20 [0016]

【発明の効果】本発明によれば、金属、ガラス、プラス チック等の各種製品等に、種々のパターンのレーザ刻印 を行う場合、刻印するパターンの大きさや形状に広じ て、集光レンズを交換せずに、ビーム集光径を調整し、 英数字等のパターン密度の低いものは太径のドットや線 で、漢字や複雑なマーク等のパターン密度の高いものは 細径のドットや線で、視認性の高い刻印を行うことがで きる。ピーム集光径の調整は、容易かつ迅速に行えるの で、オンラインでの高速刻印に適用できる。また、金属 材料等の製造工程で材料識別のために刻印する場合にお いて、刻印深さを調整し、脱スケール処理等を行った後 でも鮮明に判読できるよう深彫り刻印を行うことができ

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明法および装置の説明図である。

【図2】本発明におけるレーザビーム径調整の説明図で

【図3】本発明におけるレーザビーム径調整の説明図で

【図4】本発明により刻印した実施例の鋼材表面を示す 図である。

【図5】従来法により刻印した従来例の鋼材表面を示す 図である。

【符号の説明】

1:レーザ光源

2:レーザピーム

3: 凹レンズ

4:凸レンズ

5:X帕ガルパノスキャナ

BEST AVAILABLE COPY

(4)

特開平7-116869

7: f θ レンズ

8:被加工物

9:レンズ間隔調整機構

10:入力装置

11: 制御用コンピュータ

12:レーザー用電源

13:パルスジェネレータ

a:レンズ間隔

D:入射ピーム径

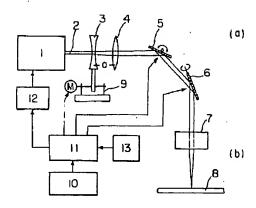
d:ピーム集光径

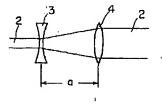
 $f:f\theta$ レンズの焦点距離

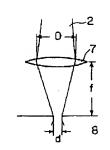
[図1].

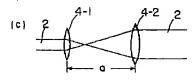
[図2]

【図4】



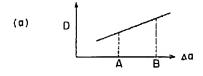




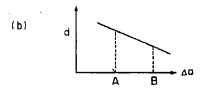


[図3]

[図5]







フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6	識別配号	· 庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
B 2 3 K 26	6/06	E			
B41J 2	2/44				
B41M 5	5/24				
G 0 2 B 26	104	A			
27	/09			•	